

Установка плазменной обработки Nano



Производитель:

Diener Electronic

Цена:

Цена по запросу

Описание

Установки серии Nano предназначены для плазмохимической обработки образцов средних размеров и групповой обработки изделий в R&D лабораториях, на опытных и мелкосерийных производствах. В бюджетных малогабаритных установках можно проводить все основные виды плазменной обработки при минимальных затратах. Различные варианты материалов камеры и типов генераторов позволяют получить конфигурацию идеально подходящую под конкретное применение.

Установки серии Nano представляют собой модификацию серии Pico с камерой увеличенного объема до 36 л, более высокой мощностью генератора и возможностью использования лодочек для групповой обработки

полупроводниковых пластин диаметром до 200 мм. Установки серии Nano могут быть изготовлены в напольном варианте корпуса с возможностью установки через стену чистого производственного помещения. Основными преимуществами установок серии Nano являются большое количество вариантов конфигурации, возможность групповой обработки полупроводниковых пластин большого диаметра, наличие корпуса для размещения установки через стену ЧПП высокого класса чистоты.

Области применения

- Керамика 60×48 мм (групповая обработка): очистка перед напылением, микросваркой; удаление остатков ФР.
- Полупроводниковые пластины до 8" (групповая обработка): очистка перед напылением, микросваркой; удаление остатков ФР.
- Печатные платы малого размера: очистка отверстий и поверхности перед монтажом.
- Обработка объемных образцов: электроника, приборостроение, медицина и др.
- R&D и исследования.